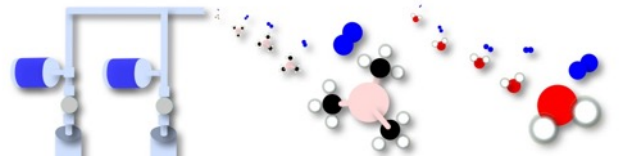
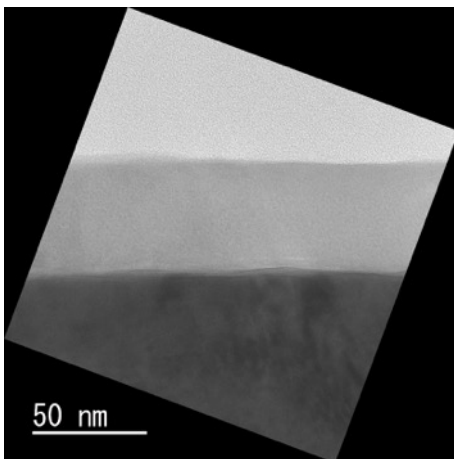


Atomic Layer Deposition

原子層堆積装置



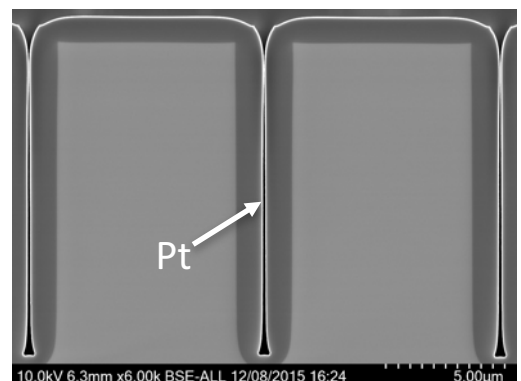
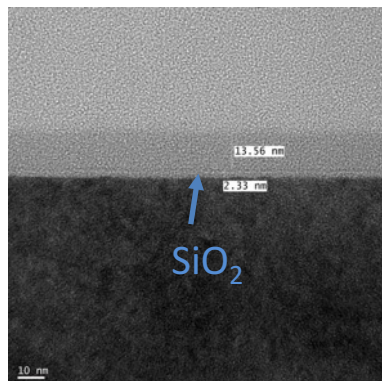
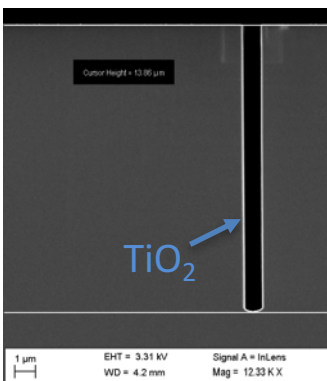
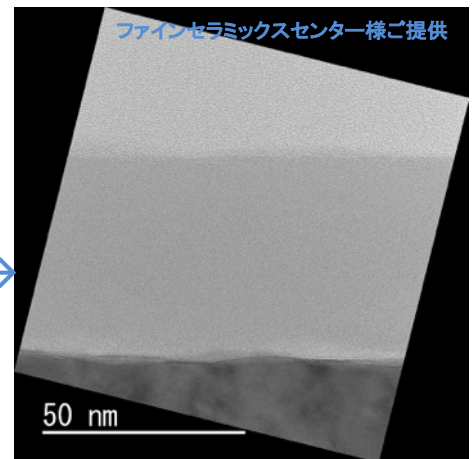
原子層堆積 (ALD) 装置 Model: AT-410 (4インチ)/AT-610 (6インチ)



← Al₂O₃, 150°C

Al₂O₃, 300°C →

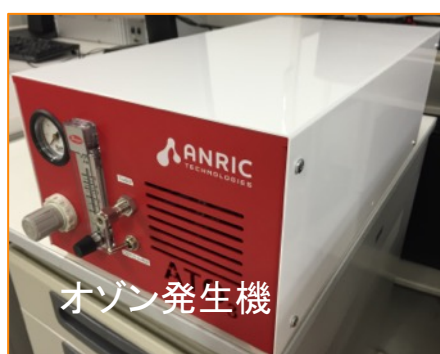
膜厚均一性:
1%以内 (4", Al₂O₃)



Anric Technologies社製

項目	仕様
設置面積	幅:493 x 奥行:454 x 高さ: 395mm
基板(試料)最大サイズ	○ 4インチ (100mm) 又は 6インチ(150mm)
プリカーサー	最多5ライン (有機金属 3ライン含む)
プリカーサー投入量	安定供給方式
加熱方式	ホットウォール式
反応室の最高温度	350°C (プリカーサー加熱: Max 150°C)
標準プロセス	Al ₂ O ₃ , TiO ₂ , ZnO, ZrO ₂ , HfO ₂ , Pt, Ru etc

(その他プロセス開発もご相談ください。)



オゾン発生機

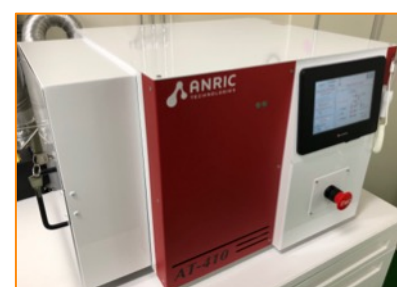


グローブボックス付き



ユーティリティー

項目	仕様
プリカーサーボトル	50cc、ベローズバルブ付、VCR
キャリアガス	高純度N ₂ (又はAr)、VCR
圧縮空気	0.5 - 0.6MPa、1/4"
真空ポンプ	ロータリーポンプ or ドライポンプ
排気ライン	NW25
電源	100/115V, 単相 (50/60Hz)



輸入総代理店:

ALDジャパン株式会社

〒183-0056 東京都府中市寿町1-3-10-401

Phone: 042-360-3152 Fax: 042-633-0916

E-mail: sales@aldjapan.com

 www.aldjapan.com